

11

(c) 1991

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОЙ УПОРЯДОЧЕННОСТИ ПЛЕНОК  
ЖЕЛЕЗО-ИТТРИЕВОГО ГРАНАТА  
НА ЭМИССИЮ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ

Л.С. Ильинский, А.А. Лаврентьев

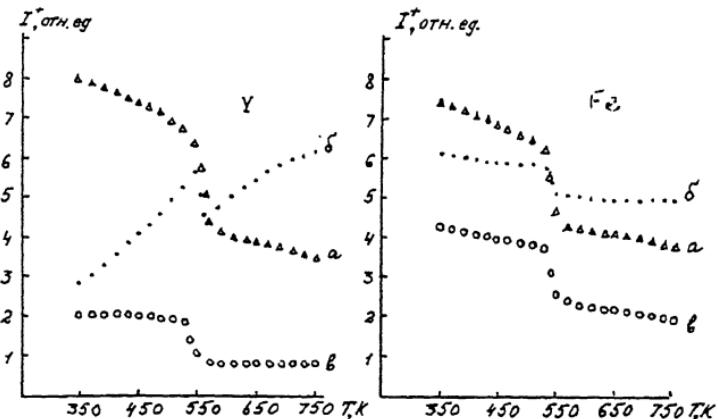
Особенности изменения эмиссии вторичных частиц под действием ионной бомбардировки при фазовых переходах представляют интерес при изучении механизмов взаимодействия атомных частиц с поверхностью твердого тела.

Для ферромагнитных материалов зависимости коэффициентов распыления и вторичной ионной эмиссии наиболее полно изучены в работах [1, 2]. В качестве мишней использовались никель, кобальт и другие материалы. Обнаружено изменение выходов атомов и ионов под действием ионной бомбардировки при переходе материалов из ферромагнитного в парамагнитное состояние. Как правило, наблюдается увеличение коэффициентов распыления и уменьшение эмиссии вторичных ионов, что связывается с изменением энергии связи атомов и плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми.

Представляет интерес определение характера изменения коэффициента распыления и вторичной ионной эмиссии при изменении магнитной упорядоченности многокомпонентных ферромагнитных материалов. В качестве такого материала использовались монокристаллические пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ)  $Y_3Fe_5O_{12}$ . ЖИГ переходит из упорядоченного ферромагнитного в неупорядоченное парамагнитное состояние при  $T = 550$  К. Исследования проводились на вторично-ионном анализаторе, созданном на базе статического масс-спектрометра МИ-1201Б. Эпитаксиальные пленки ЖИГ толщиной 12 мкм распылялись пучком ионов  $Ar^+$  с энергией 6 кэВ под углом  $60^\circ$  относительно нормали к поверхности. Плотность ионного тока составляла  $2 \cdot 10^{-3}$  А/см<sup>2</sup>. Давление в рабочей камере поддерживалось на уровне  $4 \cdot 10^{-6}$  Па. Нагрев образца в температурном диапазоне 300...800 К осуществлялся электронной бомбардировкой.

Полный коэффициент распыления ЖИГ определялся посредством измерения скорости распыления при фиксированной температуре. Глубина кратера травления оценивалась с помощью профилометра. Шаг изменения температуры составлял  $\Delta T = 20$  К. Обнаружено, что полный коэффициент распыления ЖИГ в парамагнитном состоянии в 2.5...3.0 раза больше, чем в ферромагнитном состоянии.

Нами регистрировались энергетические спектры вторичных ионов основных компонентов пленок ЖИГ, находящихся в ферромагнитной



Температурная зависимость ионного выхода компонентов ЖИГ:  
а – энергетическое окно 0... 40 эВ; б, в – низкоэнергетичная  
и высокоэнергетичная составляющие спектра вторичных ионов  
соответственно.

и парамагнитной фазах. Измерения показали, что при переходе через точку Кюри происходит трансформация формы кривой энергетического распыления и смещение максимума распределения. При этом характер изменения спектра различен для ионов  $Y^+$  и  $Fe^+$ . Энергетический сдвиг происходит в область меньших энергий и для  $Y^+$  составляет  $\Delta E=2$  эВ, а для  $Fe^+$   $\Delta E=6$  эВ. При комнатной температуре положение максимума энергетического распределения  $E_m$  для  $Y^+$  и  $Fe^+$  отличается на 6 эВ,  $E_m(Y) < E_m(Fe)$ .

Авторами ранее исследована температурная зависимость ионно-ионной эмиссии компонентов ЖИГ [3, 4]. Регистрировались пики вторичных ионов  $Y^+$ ,  $Fe^+$ ,  $Fe^{3+}$  в широком энергетическом диапазоне  $\Delta E=0...40$  эВ. В настоящей работе изучен характер изменения вторично-ионного сигнала компонентов ЖИГ для низкоэнергетичной и высокоэнергетичной составляющих энергетического спектра вторичных ионов. На рисунке показаны зависимости ионного выхода от температуры. Из представленных кривых видно, что при переходе из упорядоченного в неупорядоченное магнитное состояние иммеет место аномальное уменьшение сигнала вторичных ионов основных компонентов ЖИГ. В то же самое время характер изменения ионного выхода  $Y^+$  и  $Fe^+$  в широком температурном диапазоне различен для низкоэнергетичной и высокоэнергетичной составляющих спектра. Для ионов иттрия, покидающих поверхность с низкими энергиями (до положения максимума  $E_m$ ), наблюдается увеличение сигнала с ростом температуры, в то время как ток ионов с высокими энергиями уменьшается. Температурная зависимость выхода вторичных ионов железа имеет ниспадающий характер как для низкоэнергетичной, так и для высокоэнергетичной составляющих. Анализ кривых энергетического распределения и характера изменения ионного выхода различных компонентов

ЖИГ в состояниях магнитной упорядоченности и парамагнитном позволяет сделать следующие выводы. Различие в положении максимума энергетического распределения для ионов  $Y^+$  и  $Fe^+$  говорит о различном значении энергии связи атомов иттрия и железа на поверхности пленки. При этом предполагается, что в области максимума формы кривых энергетического распределения распыленных атомов и ионов идентичны. В результате преимущественного распыления одной из компонент изменяется состав распыляемой поверхности и как следствие нарушается кристаллическая и электронная структура поверхности. Кроме того, энергия связи атомов в парамагнитном состоянии меньше, чем в ферромагнитном (максимум энергораспределений сдвигается влево на несколько электронвольт при переходе через точку Кюри). Уменьшение энергии связи в парафазе приводит к увеличению выхода атомов при ионной бомбардировке. Магнитная упорядоченность материала пленок ЖИГ влияет и на долю распыленных ионов с низкими и высокими энергиями. Это связано с вероятностью нейтрализации выбитых ионов вблизи границы вакуум-твердое тело. Различный характер в поведении сигнала компонентов с разными энергиями может говорить об отличных механизмах ионообразования для атомов иттрия и железа.

#### Список литературы

- [1] Yurasova V.E. // Vacuum. 1986. V. 36. N 10. P. 609.
- [2] Евдокимов И.Н., Юрасова В.Е. // Поверхность. 1988. № 9. С. 5.
- [3] Ильинский Л.С., Лаврентьев А.А. // Тез. докл. Всесоюз. конф. „Ионно-лучевая модификация материалов“. Каунас, 1989. С. 111.
- [4] Ilyinskij L., Lavrentjev A. // Vacuum. 1991. V. 42. N 1/2. P. 173.

Поступило в Редакцию  
9 апреля 1991 г.